

「특허법 부분조항 개정 초안」입법원 통과

경제부 지혜재산국 ("지혜국", 한국의 특허청 상당기관)은 입법원이 2019년 4월 16일 "특허법 부분조항 개정 초안"을 통과시켰으며 디자인 특허보호기간이 12년에서 15년으로 연장되어 대만의 디자인 산업발전에 도움이 될 것이라는 보도자료를 발표했다; 발명 및 새로운 특허 승인의 분할에 대한 제한을 완화; 특허구제 안건의 심사효율성을 개선하고 보다 완벽한 특허 보호 시스템을 수립했다.

지혜국은 법규 완화 그리고 국제규범조정 준수 및 특허심사 실무의 완비를 위하여, 특허법 부분 조항의 개정안 초안을 제안했으며, 2019년 12월 27일 행정원 위원회는 입법원의 심의를 승인했으며, 금회 수정안은 총 17건으로 주요 수정의 내용은 다음과 같다:

1. 승인후 분할의 적용 범위 및 기간 확대

현행 규정은 발명 특허의 승인후 30 일로부터 분할이 가능한 것으로 제한되어 있는데, 이번 수정안에서는 발명특허 신청안 최초 승인 또는 재심사 승인 후 3 개월 이내에 발명특허의 분할이 가능한 것으로 완화했다; 아울러 새로운 특허에도 적용할 수 있도록 범위를 확대했다.

2. 무효화 심사절차 개선

무효화 심사과정중, 양당사자가 끊임없이 이유, 증거 또는 제출서를 갱신하여, 심사가 지연되는 것을 막기 위하여, 이번 수정안에서는 무효화 심사는 3개월내 그 이유를 보충하고 만약 그 기간이 넘는 경우, 심사하지 않는 것으로 했다; 아울러 해당 무효화 안건의 심사기간은 특허권자가 수정할 기간을 신청할 수 있도록 했다.

3. 실용특허(Utility Patent) 신청 개정안의 기간 및 심사 방식 수정

실용특허는 실질심사를 아직 거치지 않았기 때문에 실용특허 권리범위는 사후 수정을 통하여 변경할 수 있고 따라서 제3자의 권익에 영향을 줄 수 있는 것을 방지하기 위하여, 실용특허 신청개정의 시간을 수정하고, 현행 형식 심사를 실질심사로 개정한다.

4. 디자인특허(Design Patent) 권리 기한 12년을 15년으로 연장

제네바 개정협정의 디자인특허 권리가 15년인 점을 참고하고, 디자인 특허권의 보호 강화하기 위하여, 디자인특허권 기간을 12년에서 15년으로 연장하여, 대만 디자인 산업의 발전에 도움이 되고자 한다.

5. 특허파일 저장 공간부족우려에 대한 해결

현행 규정에 따르면 특허 파일은 영구히 보관해야 하며, 이미 210 만건 넘는 파일이 축적되어, 지속적으로 파일 보관 공간을 확장해야하는 심각한 문제를 야기하고 있다. 따라서, 정기보존분류에 대한 국제 규정을 참고로 하여, 보존 가치가 없는 파일은 정기적으로 폐기하고, 파일저장 공간 문제를 해결하도록 한다.

지혜국은 금회 법개정을 통해 실질적으로 법규를 완화하고, 특허심사효율을 제고하고, 기업특허구조에 유리하고 대만 공업디자인의 발전을 도모하고자 하기에, 앞으로도 적극적으로 홍보할 것이고, 대중에게 금회 개정 내용을 이해시키도록 한다. (2019.04)